



第83回 OPERA研究交流セミナー

第76回 ISIT有機光エレクトロニクス研究特別室セミナー

第143回 未来化学創造センターセミナー

日時:2013年4月3日(水) 13:30-16:00

場所:九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究棟 3F会議室



「電子ビーム描画装置JBX-5500SCの概要と操作方法」

日本電子株式会社 SE事業ユニット
小澤 寛司

電子ビーム描画装置は、半導体製造装置用のフォトマスク作成から微細加工を必要とする半導体デバイス、光デバイス、量子効果デバイスなどの研究開発において用いられるツールの一つであり、その加工精度と解像度の高さから応用範囲はますます広がっている。

JBX-5500SCは、ナノメートルからサブミクロンサイズのパターン描画を目的としたスポットビーム型の電子ビーム描画装置であり、最小加工寸法10nm以下のパターンを作成出来る高分解能描画モードと、比較的大面積のパターンを短時間で描画するための高速描画モードを搭載している。また、計算機システムにはWindowsOSを搭載したPCを採用し、描画パターンやジョブ・スケジュールの作成から装置較正、描画までをシンプルにすることで、高い操作性を実現している。

今回は、JBX-5500SCの概要について説明するとともに、その操作方法をアプリケーションの実例とノウハウを交えて解説する。

**主催:九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センター
:財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)
共催:九州大学 未来化学創造センター**